PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-261939

(43)Date of publication of application: 26.09.2001

(51)Int.Cl.

CO8L 63/00 C08K 5/3415 C08K 7/16 H01L 21/52

(21)Application number: 2000-078107

(71)Applicant : SUMITOMO BAKELITE CO LTD

(22)Date of filing:

21.03.2000

(72)Inventor: OUNAMI KAZUTO

OKUBO HIKARI

MURAYAMA RYUICHI

(54) LIQUID RESIN COMPOSITION AND SEMICONDUCTOR DEVICE BY USING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid resin composition with high reliability, exhibiting good reflow resistance even if a reflow temperature is changed to 260° C according to the trend directed to lead-free state, and further to provide a package with the high reliability by using the liquid resin composition. SOLUTION: This liquid resin composition comprises a filler (A), a liquid epoxy resin (B), a bismaleimide compound and/or a prepolymer thereof (C), and a curing agent (D), regulated so that the amount of the component (C) may be 4-35 pts.wt. based on 100 pts.wt. epoxy resin (B). The semiconductor device is obtained by using the liquid resin composition as a die attach paste.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

11.01.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-261939 (P2001-261939A)

(43)公開日 平成13年9月26日(2001.9.26)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
COST 63/0		C08L 63/00	C 4J002
COSK 5/3		C08K 5/3415	5 F 0 4 7
7/16		7/16	
H01L 21/5		H01L 21/52	E
		客查請求 未請求 請求	R項の数2 OL (全 5 頁)
(21)出願番号	特顧2000-78107(P2000-78107)	(71)出額人 000002141	
			ライト株式会社
(22)出顧日	平成12年3月21日(2000.3.21)	東京都品川区東品川2丁目5番8号	
		(72)発明者 涛 一登	
			区東品川2丁目5番8号 住友
			卜株式会社内
		(72)発明者 大久保 光	
			玄東品川2丁目5番8号 住友
			卜株式会社内
		(72)発明者 村山 竜一	
		l l	区東品川2丁目5番8号 住友 ト株式会社内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液状樹脂組成物及びそれを用いた半導体装置。

(57)【要約】

【課題】 鉛フリー化の動向に伴い、リフロー温度が260℃に変更されても良好な耐リフロー性を示す高信頼性の液状樹脂組成物を提供し、ひいては本発明の液状樹脂組成物を使用することで高信頼性のパッケージを提供することである。

【解決手段】 フィラー(A)、液状エポキシ樹脂 (B)、ビスマレイミド化合物及び/又はそのプレポリマー(C)、硬化剤(D)からなり、(C)の量がエポキシ樹脂(B) 100重量部に対して $4\sim35$ 重量部である液状樹脂組成物である。更にこの液状樹脂組成物をダイアタッチペーストとして用いた半導体装置である。

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 フィラー(A)、液状エポキシ樹脂(B)、一般式(1)で示されるビスマレイミド化合物及び/又はそのプレポリマー(C)、硬化剤(D)から* ま(1)

1

*なり、(C)の量が該液状エポキシ樹脂100重量部に対して4~35重量部であることを特徴とする液状樹脂組成物。

【化1】

$$\begin{array}{c|c}
0 & R1 \\
\hline
 & N \\
\hline
 & N \\
\hline
 & N \\
\hline
 & R2 \\
\hline
 & R4 & O
\end{array}$$

(R1~R4は水素あるいはアルキル基を示し、互いに同一であっても異なっていてもよく、Xは2個の脂肪族及び/又は芳香族残基を示す。)

【請求項2】 請求項1記載の液状樹脂組成物をダイアタッチ材として使用されたことを特徴とする半導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は I C 、 L S I 等の半 導体素子を金属フレーム等に接着する液状樹脂組成物に 関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年の環境問題への意識の向上に伴い半導体製品を有機基板に搭載する工程で使用されていた半田を鉛フリーの半田に置き換える検討が盛んになされている。このためリフロー温度も従来の220℃あるいは240℃から260℃へ変更する必要があり、半導体製品構成部材もより高温での耐リフロー性が要求され始め 30ている。しかし、従来のダイアタッチ材では240℃ま※

※ でのリフロー温度では使用可能であったが 260 ℃リフローに耐えるものは存在しなかった。

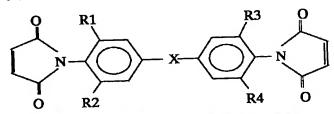
[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は鉛フリー化の 動向に伴い、リフロー温度が260℃に変更されても良 好な耐リフロー性を示す高信頼性の液状樹脂組成物を提 供し、ひいては本発明の液状樹脂組成物を使用すること で高信頼性のパッケージを提供することである。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明はフィラー(A)、液状エポキシ樹脂(B)、一般式(1)で示されるビスマレイミド化合物及び/又はそのプレポリマー(C)、硬化剤(D)からなり、(C)の量が液状エポキシ樹脂100重量部に対して4~35重量部である液状樹脂組成物である。

【化2】



(R1~R4は水素あるいはアルキル基を示し、互いに同一であっても異なっていてもよく、Xは2個の脂肪族及び/又は芳香族残基を示す。)

【0005】また、上記の液状樹脂組成物をダイアタッ チ材として使用して作製された半導体装置である。

[0006]

【発明の実施の形態】本発明に用いるフィラーは用いる分野が半導体用途のためハロゲンイオン、アルカリ金属イオン等のイオン性不純物量が10ppm以下であることが望ましい。また要求特性により銀、金、銅、ニッケルなどの金属フィラー、シリカ、窒化アルミ、窒化ボロ 50

ンなどの無機フィラーをあるいは焼成フェノール粒子、 ポリイミド粒子等の有機フィラーを単独あるいは併用し て使用可能である。

【0007】形状としてはフレーク状、繊維状、樹脂状、不定形あるいは球状のものを単独あるいは混合して用いることができる。さらに粒径に関しては通常平均粒径が $2\sim10~\mu$ m、最大粒径は $50~\mu$ m程度のものが好ましく、比較的細かいフィラーと粗いフィラーを混合し

て用いてもよい。

【0008】また本発明に用いるエポキシ樹脂は液状の 物に限定しているが、常温で液状の物でないとフィラー との混練において溶剤が必要となる。溶剤は気泡の原因 となり硬化物の接着強度、熱伝導率を低下させてしまう ので好ましくない。ここで常温で液状のエポキシ樹脂と は、例えば常温で固形のものでも常温で液状のエポキシ 樹脂と混合することで常温で安定して液状を示す物を含 む。また半導体用途に用いるため、加水分解性塩素量が 1000ppm以下であることが望ましい。

【0009】これらの要件を満足するエポキシ樹脂であ れば、特に限定されるものではないが、具体例を挙げる と、ビスフェノールAジグリシジルエーテル、ビスフェ ノールFジグリシジルエーテル、3, 3' ージアリルビ スフェノール A ジグリシジルエーテル、フェノールノボ ラックやクレゾールノボラック類とエピクロルヒドリン との反応により得られるポリグリシジルエーテル、1、 6ージヒドロキシナフタレンジグリシジルエーテル、 N, N-ジグリシジルアミノ-1, 3-グリシジルフェ ニルエーテル等があり、これらは単独でも混合して用い ても差し支えない。 さらには n ーブチルグリシジルエー テル、バーサティック酸グリシジルエステル、スチレン オサイド、エチルヘキシルグリシジルエーテル、フェニ ルグリシジルエーテル、クレジルグリシジルエーテル、 ブチルフェニルグリシジルエーテル等のような通常のエ ポキシ樹脂の希釈剤として用いられるものがあり、これ らを混合して用いても差し支えない。

【0010】本発明で使用される一般式(1)で示され るビスマレイミド化合物は、ジアミンと無水マレイン酸 とを反応させて得られるビスマレアミド酸を、更に脱水 30 閉環イミド化したものである。このビスマレイミドをさ らに芳香族ジアミンと200℃以下の温度で反応させる ことによりプレポリマーを得ることが可能である。この ようにして得られたビスマレイミド及び/又はそのプレ ポリマーは耐熱性に優れており、2種以上を組み合わせ て用いることも可能である。

【0011】本発明で使用されるビスマレイミド化合物 は、一般式(1)で示されるものであれば特に限定され るものではないが、具体例を挙げると、N, N'ー (4, 4'ージフェニルメタン) ビスマレイミド、 ビ ス(3ーエチルー4ーマレイミドフェニル)メタン、ビ ス(3、5ージメチルー4ーマレイミドフェニル)メタ ン、ビス(3, 5ージエチルー4ーマレイミドフェニ ル) メタン、ビス(3-エチル-5-メチル-4-マレ イミドフェニル) メタン、2, 2ービス〔4ー(4ーマ レイミドフェノキシ) フェニル) プロパン、2, 2ービ ス〔3-ターシャリーブチル-5-メチル-4-(4-マレイミドフェノキシ)フェニル)プロパン、2,6-ビス [2-(4-マレイミドフェニル) プロピル] ベン ゼン、等があり、これらは単独で用いても混合して用い 50

ても差し支えない。

【0012】本発明の液状樹脂組成物は、成分(A)の フィラー、成分(B)の液状エポキシ樹脂、成分(C) のビスマレイミド化合物及び/又はそのプレポリマー、 成分(D)の硬化剤から成るが、成分(B)の液状エポ キシ100重量部に対して成分(C)は4~35重量部 であることが好ましく、更に5~30重量部であること がより好ましい。260℃での耐リフロー性の向上に は、高温時の物性低下を抑えるために高耐熱性が必要で あるが、(C)が(B)に対して4重量部未満の場合、 Tgの上昇、熱時接着強度の改善といった効果が乏しく なり、また35重量部を越えると著しく粘度が上昇し、 作業性の悪化を招くため好ましくない。

【0013】本発明で使用される硬化剤についてはイオ ン性不純物が極めて少ないことが好ましい点を除きフェ ノール系化合物、有機酸無水物、アミン化合物などの使 用が可能であり構造については特に限定されない。また 必要に応じ、3級アミン、イミダゾール類、トリフェニ ルホスフィン、テトラフェニルホスフィンテトラフェニ ルボレート等といった硬化促進剤として知られている化 合物を添加することもでき、さらに可とう性付与剤、消 泡剤、カップリング剤等を用いることもできる。

【0014】本発明の製造方法は例えば各成分を予備混 合した後、3本ロールを用いて混練し、混練後真空下脱 泡し樹脂ペーストを得るなどがある。 本発明の液状樹脂 組成物をダイアタッチ材として使用した半導体装置は信 頼性の高い半導体装置である。半導体装置の製作は従来 の公知の方法を用いることが出来る。

[0015]

【実施例】以下実施例を用いて本発明を具体的に説明す る。配合割合は重量部で示す。

<実施例1~3>粒径1~30μmで平均粒径3μmの フレーク状銀粉(以下銀粉)とビスフェノールAとエピ クロルヒドリンとの反応により得られるジグリシジルビ スフェノールA(エポキシ当量180、常温で液体、以 下ビスAエポキシ)、クレジルグリシジルエーテル(エ ポキシ当量185)、ビス(3-エチルー5-メチルー 4 ーマレイミドフェニル) メタン、フェノールノボラッ ク(水酸基当量104、軟化点80~90℃)、ジシア ンジアミド、2-エチル-4-メチルイミダゾールを第 1表に示す割合で配合し、3本ロールで混練して液状樹 脂組成物を得た。この液状樹脂組成物を真空チャンバー にて2mmHgで30分間脱泡した後以下の方法により 各種性能を評価した。

【0016】・粘度: E型粘度計(3°コーン)を用い 25℃、2.5rpmでの値を測定し粘度とした。 Tg:4x20x0.4mmの試験片を作製し(硬化 条件150℃60分)引っ張りモードのTMAで測定し TMA曲線の屈曲点をもってTgとした。(測定長:1 0 mm、温度範囲:-100℃~300℃、昇温速度:

10

20

30

10℃/分)

【0017】・接着強度:6×6mmのシリコンチップを液状樹脂組成物を用いて、42合金、銅、銀メッキを施した銅フレームに各々マウントし、150℃オーブン中60分間硬化した。硬化後自動マウント強度測定装置(DAGE PC-2400)を用い260℃での熱時ダイシェア強度を測定した。また硬化後のサンプルを85℃85%72時間吸水処理し260℃での熱時ダイシェア強度を測定した。吸湿処理による保持率を計算し80%以上の場合を合格とした。

【0018】・リフロー性: $14 \times 20 \times 2$. 0mmのQFPフレーム(42合金及び銀メッキを施した銅フレーム、ダイパッド: 9.5×9.5 mm)に液状樹脂組成物を用い $9 \times 9 \times 0.38$ mmのシリコンダイをマウント、 150×60 分硬化した後、ビフェニル系封止材(フィラー含有率: $88 \times 1\%$)にてモールドした。このパッケージを $85 \times 85 \times 85$ RHの条件で168時間吸湿処理後 IRリフローを3回通した。リフロー温度は 260×10 PU上10秒とし、リフロー処理後のパッケージを透過型の超音波探傷装置により剥離の観察をおこない、剥離面積がダイパッド面積の5%以上のものを不良とし、10パッケージ中の不良パッケージ数をもってリフロー性の指標とした。

【0019】<実施例4>ビス(3ーエチルー5ーメチルー4ーマレイミドフェニル)メタンに換えてケルイミドB601(チバ・ガイギー社製)を使用した他は、実施例1と同様にして液状樹脂組成物を作製し評価した。

【0020】<比較例1~3>第1表に示す配合割合で 実施例1と同様にして液状樹脂組成物を作製し、実施例 1と同様に評価をおこなった。

【0021】評価結果を表1に示す。

【表1】

2-00 0.9 0.4 219 8.83 썯

比較例3では、液状樹脂組成物の粘度が極めて高く濡れ 拡がり性が悪化したため、良品の試験片およびパッケー ジを作製することができなかった。

[0022]

【発明の効果】本発明の液状樹脂組成物は260℃の高 40 温でも金属フレームに対する密着性に優れるため、リフロー温度が260℃になっても半田処理時に剥離、クラックが発生しない従来になかった高信頼性の半導体素子接着用の液状樹脂組成物である。

フロントページの続き

F ターム(参考) 4J002 CD041 CD051 CD061 CD131 DA079 DF019 DJ019 EJ008 EL026 EU027 EU118 EW018 FD019 FD148 CQ05 5F047 AA11 BA23 BA34 BB11 BB16